



中华人民共和国国家标准

GB/T 16527—1996

硬面感光板中光致抗蚀剂和 电子束抗蚀剂规范

Specification for photoresist/E-beam
resist for hard surface photoplates

1996-09-09 发布

1997-05-01 实施

国家技术监督局 发布

前 言

本标准等效采用 SEMI 标准 SEMI P3—90《硬面感光板中光致抗蚀剂和电子束抗蚀剂规范》。

本标准第 5 章要求中 5.2 条和 5.3 条均按 SEMI P3—90 制定,且根据产品使用方的需要,增加了 5.1 条抗蚀剂涂层性能。

SEMI 标准是半导体设备和材料国际标准,具有较高的科学性和先进性,内容全面,标准配套。本标准与已经转化为我国标准的 SEMI P1—92《硬面光掩模基板》(GB/T 15871—1995)、SEMI P2—86《硬面光掩模用铬薄膜》(GB/T 15870—1995)、SEMI P4—92《圆形石英玻璃光掩模基板规范》(GB/T 16523—1996)、SEMI P6—88《光掩模对准标记规范》(GB/T 16524—1996)及准备转化为我国标准的 SEMI P21—92《掩模曝光系统准确度表示准则》、SEMI P19—92《用于集成电路制造技术的检测图形单元规范》等项标准形成一个微型构图标准系列。

本标准附录 A 是提示的附录。

本标准由中华人民共和国电子工业部提出。

本标准由电子工业部标准化研究所归口。

本标准起草单位:长沙韶光微电子总公司、电子工业部标准化研究所。

本标准主要起草人:谈仁良、吴保华、王亦林、韩艳芬。

中华人民共和国国家标准

硬面感光板中光致抗蚀剂和 电子束抗蚀剂规范

GB/T 16527—1996

Specification for photoresist/E-beam
resist for hard surface photoplates

1 范围

本标准规定了硬面感光板中光致抗蚀剂和电子束抗蚀剂涂层的要求、试验方法等内容。
本标准适用于硬面感光板中光致抗蚀剂和电子束抗蚀剂的涂层检验。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

- GB 191—90 包装储运图示标志
- GB 2828—87 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
- GB 2829—87 周期检查计数抽样程序及抽样表(适用于生产过程稳定性的检查)
- GB 7238—87 玻璃及铬版表面平整度的测试方法
- GB 7239—87 铬版铬膜和胶膜厚度的测试方法
- GB/T 15871—1995 硬面光掩模基板
- GB/T 15870—1995 硬面光掩模用铬薄膜
- SJ/T 10584—94 微电子学光掩蔽技术术语

3 定义

本标准采用 SJ/T 10584 中的定义。

4 分类与命名

抗蚀剂涂层符合本标准的硬面感光板基板应满足 GB/T 15871 和 GB/T 15870 规定的要求。抗蚀剂的分类与型号命名按附录 A(提示的附录)规定,主要依据如下(订货文件中应予注明):

- a) 抗蚀剂材料;
- b) 在质量区内抗蚀剂的厚度及其公差;
- c) 整个质量区抗蚀剂的均匀性;
- d) 板与板之间抗蚀剂的一致性;
- e) 抗蚀剂的焙烘时间和温度。

5 要求和测试方法

5.1 抗蚀剂涂层性能

国家技术监督局 1996-09-09 批准

1997-05-01 实施